

2004B 利用期 トライアルユース実施課題 (表1-2)

【重点領域】 薄膜: 薄膜の構造解析、微量XAFS: 微量元素の局所構造解析

番号	重点領域	課題番号	課題名	実験責任者	所属	シフト数	BL	共同実験機関
1	微量XAFS	2004B0111-NI-np-TU	XAFSによる新規PDP用青色蛍光体CaMgSi ₂ O ₆ :Euの発光中心周辺環境の解析	國本 崇	徳島文理大学	3	BL01B1	住友化学工業, 高輝度光科学研究センター, 鳥取大学
2		2004B0201-NI-np-TU	放射光を用いた新規高性能ポリイミド単繊維の高応力下における結晶構造変化の測定	佐藤 和彦	帝人(株)	9	BL46XU	高輝度光科学研究センター, 神戸大学
3	薄膜	2004B0243-NI-np-TU	磁気ディスク用フッ素系潤滑剤の吸着厚み、形態、およびその内部構造に関するX線の測定	坂根 康夫	(株)松村石油研究所	6	BL19B2	高輝度光科学研究センター
4	薄膜	2004B0329-NI-np-TU	微小角入射X線散乱によるアモルファスIZO膜の構造解析	島根 幸朗	出光興産(株)	6	BL46XU	東京大学, 釜山大学, 青山学院大学, 高輝度光科学研究センター
5	薄膜	2004B0331-NI-np-TU	X線反射率測定及び反射小角散乱による液晶配向膜の評価	筒井 皇晶	日産化学工業(株)	6	BL19B2	高輝度光科学研究センター
6	微量XAFS	2004B0361-NI-np-TU	緑色蛍光体CSSIにおけるCeイオン近傍の結晶場の解析	茂岩 統之	(株)三菱化学科学技術研究センター	3	BL01B1	高輝度光科学研究センター
7	微量XAFS	2004B0362-NI-np-TU	Zn添加Y ₂ O ₃ :Eu蛍光体におけるZnの局所構造解析	中西 洋一郎	静岡大学	3	BL19B2	高輝度光科学研究センター, 双葉電子工業
8	薄膜	2004B0364-NI-np-TU	斜入射X線小角散乱による、Nano-Clustering Silica膜の空隙評価	淡路 直樹	(株)富士通研究所	6	BL19B2	
9		2004B0370-NI-np-TU	Ce賦活Gd ₂ SiO ₅ 系シンチレータ材料における賦活剤および添加剤置換サイトの解析	八木 康洋	日立化成工業(株)	6	BL01B1	高輝度光科学研究センター
10		2004B0371-NI-np-TU	燃料電池用カーボン電極材料の精密構造解析	今井 英人	日本電気(株)	3	BL19B2	
11		2004B0384-NI-np-TU	XAFS測定による酸化チタン担持金触媒の化学構造解析	斉藤 昇	(株)日本触媒	3	BL19B2	高輝度光科学研究センター
12	薄膜	2004B0493-NI-np-TU	Hfシリケート薄膜の動径分布測定	竹村 モモ子	(株)東芝	9	BL46XU	高輝度光科学研究センター, 東芝ナノアナリシス
13		2004B0617-NI-np-TU	位相コントラスト法によるリチウム電池の金属リチウム電極の観察	島川 祐一	京都大学	3	BL19B2	住友電気工業, 高輝度光科学研究センター
14	微量XAFS	2004B0677-NI-np-TU	銀発色したフロートガラス表面における銀および種々イオンの酸化還元状態のXAFSによる決定	滝本 康幸	旭硝子(株)	6	BL19B2	東京理科大学
15	微量XAFS	2004B0690-NI-np-TU	光増幅器用Erドープガラスの局所構造の調査	笹井 淳	旭硝子(株)	3	BL19B2	
16	薄膜	2004B0893-RI-np-TU	高性能偏光板開発のためのポリビニルアルコール中のヨウ素アニオンのXAFSによる構造研究	島津 彰	日東電工(株)	3	BL19B2	高輝度光科学研究センター
17		2004B0895-RI-np-TU	ナノ結晶蛍光体をガラス中に三次元積層化した高輝度蛍光ガラスの局所構造の調査	小西 明男	日本山村硝子(株)	3	BL19B2	兵庫県立大学, 産業技術総合研究所, 佐賀県立九州シンクロナン光研究センター, 高輝度光科学研究センター
18		2004B0898-RI-np-TU	XAFS法による添加物処理したMg系水素貯蔵材料の化学結合状態分析	市川 貴之	広島大学	3	BL19B2	太平洋セメント, 三菱重工, 産業技術総合研究所
19		2004B0900-RI-np-TU	不溶化処理した鉛汚染土壌中の鉛のXAFSおよび粉末X線回折による形態分析	口舩 愛	(株)アステック	18	BL19B2	九州大学, 東京大学
20	微量XAFS	2004B0907-RI-np-TU	酸化物蛍光体中の発光イオンEuのXAFSによる状態分析	奥本 佐登志	松下電工(株)	6	BL19B2	
21		2004B0920-RI-np-TU	Sn添加IZO薄膜のSn局所構造のXAFS解析	島根 幸朗	出光興産(株)	6	BL19B2	東京大学, 高輝度光科学研究センター